

2018年1月11日  
古河電気工業株式会社

### 千葉事業所内で発生したガス漏洩に関するお知らせ

2018年1月10日（水）12時35分頃、当社千葉事業所に所在する子会社古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社の工場内でガスが建屋内に漏洩するという事故が発生しました。ご関係の皆さまにはご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

1月11日（木）15時現在で判明しております状況を下記のとおり、お知らせします。

#### 1. 発生場所

千葉県市原市八幡海岸通6番地

古河電気工業株式会社 千葉事業所内

古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社内の光半導体製造工場

#### 2. 事故の経過

1月10日（水）12時35分頃 光半導体製造工場クリーンルーム内の除害筒から黒煙を発生。有毒ガス漏れの可能性があったため、工場建屋内の従業員全員が退避した。有毒ガスを測定した結果、クリーンルーム外へ漏洩していることが確認されたため、連結する別の建屋からも従業員を全員避難させた。

1月10日（水）15時10分頃 有毒ガスの漏洩が既に停止していることを確認した。

なお、現時点で光半導体製造工場および連結する建屋のガス濃度は環境基準以下となっている。

#### 3. ガス漏洩の原因

所轄の消防署と原因調査中

#### 4. 被害状況（1月11日15時現在）

(1) 人的被害；当社従業員4名が体調不良を訴え事業所内で休養したが、産業医・保健師により治療の必要なしと判断。

(2) 物的被害；光半導体工場クリーンルーム内の除害筒が一部破損（推定）

(3) 現在の操業状況

① 光半導体用チップの製造を停止。隣接する施設の当社グループ従業員約400名は、別の建屋に避難した上、1月10日中に順次帰宅。

② 事業所敷地内のその他の工場は通常通り操業中。

(4) 製造復旧の見通し；現場検証中であり復旧の見通しは立っていません。

#### 5. 原因と対策

現在、関係ご当局の調査中ですが、千葉事業所内に「対策本部」を設置し、原因調査等を全力で進めてまいります。

原因が判明次第、関係ご当局のご指導を仰ぎつつ、適切な対策を実施します。

#### 6. 発生漏洩した有毒ガスの内容

- ・ リン系ガス、ヒ素系ガス

除害筒で無害化した生成物が空気と化学反応し、リン系ガス（ホスフィン含む）とヒ素系ガス（アルシン含む）が発生したと推測される。

内容；InGaAsP（インジウムガリウムヒ素リン）などの光半導体を製造する際に用いる無機化合物。アルシン、ホスフィン共に半導体製造工程の原料ガスとして使用している。

以 上